

2014年2月26日

高純度亜酸化窒素の拠点新設

－韓国での半導体向け高純度ガスの供給体制を強化－

昭和電工株式会社（社長：市川 秀夫）は、半導体製造用特殊ガスのひとつである高純度亜酸化窒素の供給能力を拡大します。韓国の株式会社斗岩産業（社長：朴曄、本社：京畿道安城市）との間で高純度亜酸化窒素生産に関する委託契約を締結するとともに、ソウル近郊の同社工場内に精製設備を共同で立ち上げることを決定しました。2014年中に設備を完成させ、2015年から販売を開始します。これにより、現状の当社川崎事業所における年間生産能力1,200トンに、今回の韓国での生産委託分600トンが加わり、当社グループの今後の供給能力は1,800トンに増強されます。

高純度亜酸化窒素は、半導体CVDプロセスでの絶縁酸化膜形成用ガスとして使用される特殊ガスであり、アジア地区での半導体用途での需要は年率10～15%で拡大しています。近年はディスプレイ製造時の酸化膜の酸素源としての用途も広がっております。今後も東アジアでの高純度亜酸化窒素の需要が拡大することにあわせ、当社の供給体制を強化いたします。

当社では、現在推進中の中期経営計画”PEGASUS（ペガサス）”フェーズⅡにおいて、高純度アンモニアをはじめとする半導体高純度ガスを成長事業に位置づけております。今後、アジア地区を中心にグローバル展開をさらに推進し、拡販に注力していきます。

以上

◆本件に関するお問い合わせ先 広報室 03-5470-3235